

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成18年12月21日(2006.12.21)

【公表番号】特表2006-507909(P2006-507909A)

【公表日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【年通号数】公開・登録公報2006-010

【出願番号】特願2004-570754(P2004-570754)

【国際特許分類】

A 6 1 M 11/04 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 11/04 3 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月2日(2006.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

薬剤を吸入により、又は経鼻的に配達するための装置であつて、

a) 上流開口部及び下流開口部を有するチャンバと

b) 前記上流開口部と前記下流開口部との間に於ける前記チャンバの領域で薬剤蒸気を生成する薬剤供給ユニットと、

c) エアロゾルを形成すべく前記薬剤蒸気を凝縮するのに有効な選択された流量又は流量範囲に、前記領域を流通するガス流を制限する、前記薬剤供給ユニットの上流に設けられたガス流制御弁と、

d) 前記薬剤供給ユニットをして前記薬剤蒸気を生成させる作動スイッチとを備える装置。

【請求項2】

前記薬剤供給ユニットが前記チャンバ内に収容されている、請求項1に記載の装置。

【請求項3】

前記薬剤供給ユニットが、

i) 基板と、

ii) 前記基板と関連される薬剤と、

iii) 前記基板を加熱する熱源と

を備える、請求項1に記載の装置。

【請求項4】

前記薬剤のフィルムが前記基板にコーティングされており、前記フィルムの厚さが約0.01μm～10μmである、請求項3に記載の装置。

【請求項5】

前記薬剤蒸気の生成が、前記選択された流量又は流量範囲に達した時に開始されるようになっている、請求項1に記載の装置。

【請求項6】

前記薬剤蒸気の生成が、前記選択された流量又は流量範囲に達する前に開始されるようになっている、請求項1に記載の装置。

【請求項7】

前記薬剤蒸気の生成が、前記選択された流量又は流量範囲に達する後に開始されるよう

になっている、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 8】

前記ガス流制御弁が能動的なガス制御要素を備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 9】

前記ガス流制御弁がオリフィスである、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 10】

前記作動スイッチが、前記チャンバを流通するガス流の熱散逸作用に応答するサーミスタを備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 11】

前記サーミスタを加熱するユーザ作動式スイッチをさらに備える、請求項 10 に記載の装置。

【請求項 12】

前記薬剤供給ユニットの下流で前記チャンバと連通するバイパス弁をさらに備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 13】

前記バイパス弁がオリフィスである、請求項 12 に記載の装置。

【請求項 14】

前記薬剤供給ユニットの下流で前記チャンバと連通するバイパスチャネルをさらに備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 15】

ガス流センサをさらに備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 16】

薬剤を吸入により、又は経鼻的に配達するための装置であつて、

a) 上流端及び下流端を有するチャンバと

b) 前記上流端と前記下流端との間における前記チャンバの領域で薬剤蒸気を生成する薬剤供給ユニットと、

c) エアロゾルを形成すべく前記薬剤蒸気を凝縮するのに有効な選択された流量又は流量範囲に、前記領域を流通するガス流を制限する、前記領域の上流で前記チャンバと連通する上流オリフィスと、

d) 前記薬剤供給ユニットをして前記薬剤蒸気を生成させる作動スイッチとを備える装置。

【請求項 17】

前記薬剤供給ユニットが前記チャンバ内に収容されている、請求項 16 に記載の装置。

【請求項 18】

前記薬剤供給ユニットが、

i) 基板と、

ii) 前記基板と関連される薬剤と、

iii) 前記基板を加熱する熱源と

を備える、請求項 16 に記載の装置。

【請求項 19】

前記薬剤のフィルムが前記基板にコーティングされており、前記フィルムの厚さが約 0.01 μm ~ 10 μm である、請求項 18 に記載の装置。

【請求項 20】

前記薬剤蒸気の生成が、前記選択された流量又は流量範囲に達した時に開始されるようになっている、請求項 16 に記載の装置。

【請求項 21】

前記作動スイッチが、前記チャンバを流通するガス流の熱散逸作用に応答するサーミスタを備える、請求項 16 に記載の装置。

【請求項 22】

前記サーミスタを加熱するユーザ作動式スイッチをさらに備える、請求項 21 に記載の

装置。

【請求項 2 3】

前記薬剤供給ユニットの下流で前記チャンバと連通するバイパスオリフィスをさらに備える、請求項 1 6 に記載の装置。

【請求項 2 4】

前記薬剤供給ユニットの下流で前記チャンバと連通するバイパスチャネルをさらに備える、請求項 1 6 に記載の装置。

【請求項 2 5】

ガス流センサをさらに備える、請求項 1 に記載の装置。